

半導体分析セミナー

Agilent 8900トリプル四重極 ICP-MSによる 最新事例のご紹介

開催概要

| 主催 |
アジレント・テクノロジー (株)

| 日程 |
2020年 9月 29日 (火)
2020年 10月 7日 (水)

| 時間 |
13:45 配信開始
14:00 - 15:40 セミナー

詳細は右記プログラム参照

| 参加費 | 無料

| 申込方法 |
アジレントホームページへ
アクセスし、本セミナーページ
からお申込みください。

セミナー詳細やお申込みにつきましては、ご案内の担当者までお問合せください。

お問合せ先：
アジレント・テクノロジー(株)
セミナー事務局
電話：0120-477-111
e-mail : lsca_seminar@agilent.com

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

トリプル四重極 ICP-MS による半導体最新事例をご紹介するセミナーを開催いたします。

アジレントは2012年、トリプル四重極 ICP-MS を世界で初めて発売して以来、様々な形でお客様に最新ソリューションを提供してきました。今回はオンラインセミナーで皆様にお届けいたします。特別講演として、株式会社イアス 代表取締役 川端克彦様に「半導体分野におけるオンラインICP-MS 分析」と題し、ご講演いただきます。

ご多用中のところ大変恐縮ではございますが、ご参加を心よりお待ちしております。

敬具

参加対象

- 半導体関連の分析でICP-MSをお使いの方、ご興味をお持ちのお客様

9月29日プログラム

13:45	配信開始
14:00 - 14:05	開会の挨拶
14:05 - 14:45	<p>特別講演 半導体分野におけるオンラインICP-MS分析</p> <p>半導体分野における極微量金属不純物分析として、ICP-MSを用いたオンライン分析システムについてご紹介します。 具体的には、ウェーハ、薬液、ガス分析への顧客からのニーズおよび運用方法についてご紹介します。</p> <p>ご講演：株式会社イアス 代表取締役 川端克彦様</p>
14:45 - 15:00	休憩
15:00 - 15:40	<p>Single Particle ICP-MSによるFeナノ粒子の分析</p> <p>半導体製造プロセスで使用される薬液における不純物元素の濃度管理が年々厳しくなっている中、新たな分析内容として、金属ナノ粒子測定へのニーズが高まっています。そこで特に重要な管理元素の一つであるFeに注目し、通常の定量分析の手法では困難であったFe₃O₄ 15nm粒子をppqレベルの濃度から検出可能になった詳細をご紹介します。</p> <p>講演：アジレント・テクノロジー株式会社</p>

10月7日プログラム

13:45	配信開始
14:00 - 14:05	開会の挨拶
14:05 - 14:55	<p>ICP-QQQを用いた有機溶媒中の塩素分析と反応機構の考察</p> <p>ICP-QQQを用いると従来困難であったアプリケーションも解決できる事例が多くなってきていますが、今回はその一つである有機溶媒中の塩素分析を取り上げ、反応機構ならびに分析上の注意点等をご紹介します。</p> <p>講演：アジレント・テクノロジー株式会社</p>
14:55 - 15:10	休憩
15:10 - 15:40	<p>アジレント無機分析装置をはじめ半導体関連ソリューションのご紹介</p> <p>原子吸光からICP-OES、ICP-MSまで幅広い無機分析装置によるソリューションの紹介をはじめ、アジレントの幅広い製品による半導体関連ソリューションをご紹介します。</p> <p>講演：アジレント・テクノロジー株式会社</p>